

отсутствует, т. е. барьеры на границах зерен подавлены) намного меньше (0.05 и 0.10 эВ), чем у медленного охлаждавшегося образца с ПТКС (0.17 и 0.34 эВ). На основании этого можно в первом приближении считать, что в указанных областях температур величина  $\rho$  образца с ПТКС определяется нескомпенсированными барьерами на границах зерен. Наличие в исследовавшихся образцах позисторной керамики ФНС при  $T < T_K$  нескомпенсированных барьеров подтверждается также нелинейной зависимостью тока от напряжения. Оценка величины  $n$  путем сравнения значений  $W$  и  $n\Phi$  при температурах как выше, так и ниже области ПТКС дает значения  $65 \pm 2$ . Эта величина на 15—20% меньше среднего числа межзеренных границ, определенного путем деления толщины образца на средний размер зерна (15—20 мкм).

Полученный результат согласуется с данными о том, что в позисторной и варисторной керамике потенциальные барьеры образуются не на всех границах зерен [1]. Правомерность соотнесения определенной нами величины  $\Phi$  с высотой межзеренного потенциального барьера в модели Хейванга подтверждается также хорошим совпадением экспериментальной кривой  $\rho(T)$  с зависимостью  $\rho(T)$ , рассчитанной с использованием экспериментально определенных значений  $\Phi$  по формуле  $\rho = \rho_0 \exp(\Phi/kT)$ , соответствующей барьерной модели. Значение  $\rho_0$  определялось из кривой 2 приравниванием при  $T = 300$  К экспериментального и расчетного значений  $\rho$ .

Таким образом, полученные в настоящей работе для  $PbFe_{0.5}Nb_{0.5}O_3$  результаты аналогичны результатам, полученным ранее иным методом для  $BaTiO_3$  [4], и являются еще одним прямым экспериментальным подтверждением правильности представлений, лежащих в основе барьерной модели позисторного эффекта.

#### Список литературы

- [1] Шефтель И. Т. Терморезисторы. М.: Наука, 1973. 416 с.
- [2] Полупроводники на основе титаната бария: Пер. с япон./Под. ред. В. М. Петрова. М.: Энергоиздат, 1982. 328 с.
- [3] Раевский И. П., Павлов А. Н., Прокопало О. И. // Изв. АН СССР. Сер. физич. 1987. Т. 51. № 12. С. 2262—2264.
- [4] Шустров Б. А., Шефтель И. Т., Ярмаркин В. К. // ДАН СССР. 1987. Т. 293. № 6. С. 1378—1383.
- [5] Ревский И. П., Малицкая М. А., Филиппенко В. П., Прокопало О. И., Павлов А. Н., Бондаренко Е. И. // ФТТ. 1986. Т. 28. № 10. С. 3211—3213.
- [6] Muraoka T. // Jap. J. Appl. Phys. 1966. V. 5. N 5. P. 540.
- [7] Квасков В. Б. Полупроводниковые приборы с bipolarной проводимостью. М.: Энергоатомиздат, 1988. 128 с.

Научно-исследовательский институт физики  
при Ростовском государственном университете

Поступило в Редакцию  
2 ноября 1992 г.

УДК 537.311.33

© Физика твердого тела, том. 35, № 3, 1993  
*Solid State Physics, vol. 35, N 3, 1993*

#### ПРОВОДИМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ФАЗЫ

$YBa_2Cu_3O_{6+x}$  ( $0.26 < x < 0.38$ )

В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 2—300 К

*E. И. Никулин, Ю. П. Степанов*

Соединение  $YBa_2Cu_3O_{6+x}$  наиболее полно изучено при больших содержаниях кислорода ( $x \approx 1$ ), когда оно относится к высокотемпературным сверхпроводникам

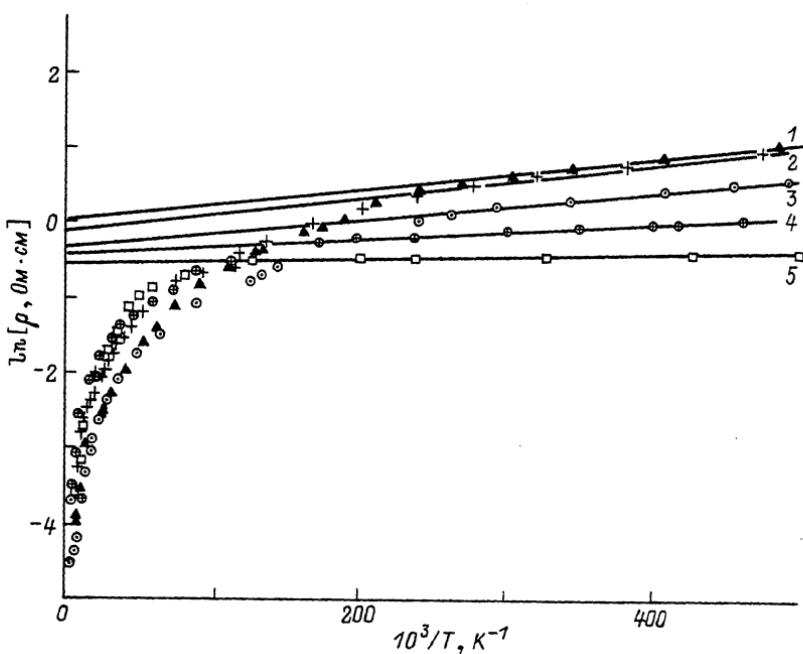


Рис. 1. Температурная зависимость удельного сопротивления образцов  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$  с различным содержанием кислорода.

$x = 0.26$  (1), 0.28 (2), 0.32 (3), 0.34 (4), 0.38 (5).

с  $T_c = 90$  К. При уменьшении содержания кислорода температура сверхпроводящего перехода уменьшается, и при  $x \approx 0.4$  сверхпроводимость исчезает и происходит фазовый переход металл—полупроводник [1]. Соединение  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_6$  является диэлектриком. При  $x > 0$  кислород выступает в роли акцептора.  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$  является дырочным проводником с концентрацией дырок  $N = 5.7 \cdot 10^{21} \text{ см}^{-3}$  [2]. Можно считать, что в промежуточной области концентраций кислорода ( $0 < x < 1$ ) концентрация дырок  $N = x \cdot 5.7 \cdot 10^{21} \text{ см}^{-3}$ .

Настоящая работа посвящена исследованию сопротивления полупроводниковой фазы  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$  в интервале температур от комнатной до 2 К при  $x = 0.38, 0.34, 0.32, 0.28$  и 0.26. Исходный материал получали керамическим методом из особо чистых окислов иттербия, меди и карбоната бария. Для обеспечения однородности образцы отжигались при 500 °C и затем медленно охлаждались. Все образцы приготовлены из одной партии, поэтому полагаем одинаково малой степенью компенсации у всех образцов.

Результаты эксперимента приведены на рис. 1, где представлена зависимость логарифма удельного сопротивления  $\rho$  от обратной температуры для образцов  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$  с различным содержанием кислорода. В начале и конце температурного интервала экспериментальные результаты могут быть аппроксимированы прямыми линиями, что соответствует известному температурному ходу сопротивления полупроводников

$$\rho = \rho_0 \exp \varepsilon / kT,$$

где  $\varepsilon$  — энергия активации. Середина интервала соответствует области температур, где ход сопротивления не отвечает какой-то одной энергии активации и наблюдается переход от одного механизма проводимости к другому. При достаточно высоких температурах ( $T > 60$  К) наклон прямых практически не зависит от

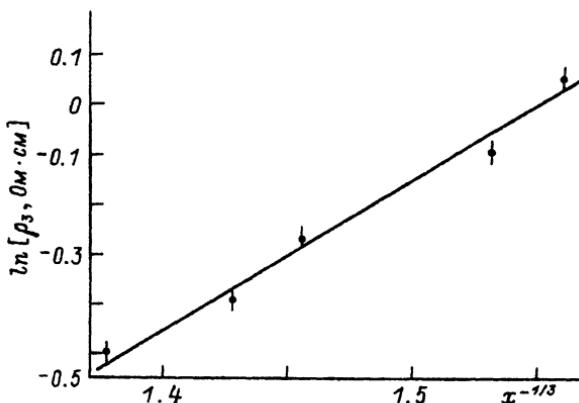


Рис. 2. Удельное сопротивление как функция содержания кислорода  $x$ .

Концентрация дырок  $N = x \cdot 5.7 \cdot 10^{21} \text{ см}^{-3}$ .

концентрации кислорода  $x$ , что соответствует одной энергии активации  $\varepsilon_1 = 15$  мэВ. Предположим, что это область вымораживания примесных носителей. В этом случае величина  $\varepsilon_1$  близка с энергией ионизации изолированной примеси  $E_0$  (разбросом уровней примеси пренебрегаем). Вычислим радиус состояния

$$a = \frac{\hbar}{\sqrt{2mE_0}}, \quad (1)$$

где  $m$  — эффективная масса носителей. Считая  $m = m_0$  ( $m_0$  — масса свободного электрона), получаем  $a = 16 \text{ \AA}$ .

При понижении температуры зависимости  $\ln \rho = f(1/T)$  становятся все более пологими, и при  $T < 5 \text{ K}$  наклон отвечает энергии активации  $\varepsilon_3$ , которая существенно меньше энергии активации  $\varepsilon_1$  в области вымораживания и уменьшается при увеличении концентрации кислорода (т. е. концентрации акцепторов) с 0.2 мэВ при  $x = 0.26$  до 0.02 мэВ при  $x = 0.38$ . Такое уменьшение энергии активации связано с возрастанием перекрытия волновых функций акцепторов и наблюдается в случае прыжковой проводимости слаболегированных полупроводников [3]. Можно предположить, что в данном температурном интервале и наблюдается прыжковая проводимость. В этом случае энергия активации  $\varepsilon_3$  обусловлена разбросом уровней примеси.

Характерной чертой прыжковой проводимости является зависимость от концентрации примеси. Экстраполируя низкотемпературную часть кривой  $\ln \rho = f(1/T)$  прямой линией к  $T^{-1} = 0$ , получаем значение  $\rho_3$ . Теория дает концентрационную зависимость прыжковой проводимости в виде

$$\rho_3 = \rho_3^0 \exp \left[ \frac{\alpha}{N^{1/3} a} \right], \quad (2)$$

где постоянная  $\alpha = 1.73$ ,  $N$  — концентрация примеси,  $a$  — радиус состояния [4].

На рис. 2 представлена зависимость  $\ln \rho_3 = f(x^{-1/3})$ . Видно, что линейная зависимость выполняется достаточно хорошо, что может служить доказательством справедливости нашего предположения о прыжковом характере проводимости. Определенный по наклону прямой радиус состояния  $a = 3 \text{ \AA}$ , что в пять раз меньше значения  $a$ , определенного с помощью формулы (1). Отметим, что в последнем случае в формулу входит величина эффективной массы носителя и

значение  $a = 16 \text{ \AA}$  получено в предположении  $m = m_0$ . Если взять  $m = 25m_0$ , то можно получить то же значение радиуса состояния, что и с помощью графика на рис. 2.

В заключение отметим, что интерпретация экспериментальных результатов основана на теории слаболегированных полупроводников, где рассматриваются концентрации примеси  $10^{15} - 10^{17} \text{ см}^{-3}$ , что на четыре порядка меньше концентрации наших образцов. Правда, в случае глубокой примеси теория работает и при более высоких концентрациях, т. е. когда мал радиус состояния. Но в нашем случае радиус состояния получается чрезвычайно малым — порядка постоянной решетки. Полагаем, что результаты настоящей работы свидетельствуют только о том, что температурный ход проводимости полупроводниковой фазы  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$  подобен тому, что наблюдается для слаболегированных полупроводников, а при низких температурах ( $T < 5 \text{ K}$ ) концентрационная зависимость проводимости аналогична прыжковой.

Авторы благодарны М. С. Бреслеру и В. Г. Флейшеру за обсуждение результатов.

#### Список литературы

- [1] Кавокин К. В., Байков Ю. М., Никулин Е. И., Степанов Ю. П. // ФТГ. 1992. Т. 34. № 3. С. 88—92.
- [2] Вендик О. Г., Козырев А. Б., Самойлова Т. Б., Попов А. Ю. // Сб.: «Высокотемпературная сверхпроводимость». Л.: Машиностроение, 1990. В. 1. С. 13—16.
- [3] Шкловский Б. И., Эфрос А. А. Электронные свойства легированных полупроводников. М.: Наука, 1979. С. 237—245.
- [4] Там же. С. 184—193.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе РАН  
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию  
2 ноября 1992 г.

---

В статье М. А. Митцева и Н. Д. Потехиной  
«Учет внутренних статсумм кластеров в теории решеточного газа»  
(ФТГ. 1992. Т. 34. № 3. С. 757—764)

допущена опечатка.

На стр. 760 в ряде мест формул (17)—(22) знак  $*$  ошибочно набран как  $^*$ .

В правой части формулы (17) следует читать  $Q_{Ai}^*$ . Дальше всюду вплоть до формулы (22)  
вместо  $Q^*$ ,  $F^*$ ,  $f^*$  следует читать  $Q^*$ ,  $F^*$ ,  $f^*$ .

В конце фразы после формулы (19) «...между  $Q_{Ai}$  и  $Q_{Ai}^*$ » следует читать «...между  $Q_{Ai}$  и  $Q_{Ai}^*$ ».